



سومین همایش علمی- تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - 23 الی 25 آذر 1387

چکیده - در این تحقیق از نرم افزار یک بعدی **PC1D** برای شبیه سازی سلول های خورشیدی استفاده شده و اثر عوامل متفاوتی مانند پوشش ضد بازتاب ، بافتدار کردن سطوح سلول و میزان چگالی ناخالصی زمینه بر روی عملکرد سلول های خورشیدی و بازدهی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش ناخالصی زمینه ، ولتاژ مدار باز (V_{oc}) افزایش و جریان اتصال کوتاه (I_{sc}) کاهش می یابد. مقدار بهینه ناخالصی زمینه ، که به ازای آن بیشترین بازدهی حاصل می گردد، حدود $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ است.

کلید واژه - بهینه سازی بازده ، پوشش ضد بازتاب ، سلول خورشیدی ، ناخالصی زمینه .

A Study of p-n Silicon Photocell Efficiency Using PC1D Code

Hadi Arabshahi¹, Minuo Dastras²

Physics Department, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

Abstract- In this paper Si diode photocell has been simulated using a PC1D software. The effects of various parameters like non-reflecting film and donor concentration on photocell efficiency have also been studied. Our results show that with increasing background impurity V_{oc} increases and I_{sc} decrease.

Keywords: photocell, non-reflecting film, donor concentration, background impurity

برای تولید انرژی مقرون به صرفه نمی باشد. سلولهای خورشیدی معمولاً از یک پیوند p-n تشکیل شده اند. برای ایجاد پیوند p-n ، ابتدا سیلیسیم را که جزء فراوانترین عناصر موجود در خاک میباشد استخراج کرده و آنرا تا حدود 99/9 درصد خالص می کنند. سپس آنرا بصورت تک بلوری یا از اصطلاحاً کریستالی در آورده و با نفوذ ناخالصی بور به آن سیلیسیم نوع p و در نهایت برای

1- مقدمه

سلولهای خورشیدی از جمله وسایل اپتوالکترونی هستند که نور خورشید را بطور مستقیم تبدیل به الکتریسیته می کنند. با توجه به کاهش روزافزون مخازن سوخت های فسیلی، نیاز اساسی برای دستیابی به این ابزار کاملاً حس می شود. در حال حاضر به علت هزینه های گزاف ساخت این سلول ها و به علاوه بازدهی بسیار پایین آنها ، استفاده از این وسایل

در عمل سعی بر این است که با انتخاب مناسب نوع و ضخامت ماده استفاده شده در پوششها، این جذب را تا حد ممکن کاهش دهند.

بحث و نتیجه گیری

چهار نوع سلول سیلیمی با ضخامت سلول $300 \mu\text{m}$ و مقاومت

ویژه بیس $8\Omega\text{-cm}$ که در مقابل تابش متوسط خورشید با شدت $0/1 \text{ w/cm}^2$ قرارگرفته اند را در نظر می‌گیریم. نمونه A را سلولی در نظر می‌گیریم که امپدانس آن با چگالی $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ و عمق $0/5 \mu\text{m}$

ناخالص شده و سطح بالایی آن دارای انعکاس ثابت 30 درصدی است. نمونه B را همانند سلول A در نظر می‌گیریم با این تفاوت که سطح آن توسط پوشش ضد بازتاب سه لایه ای $\text{SiO}_2 / \text{ZnS} / \text{MgF}_2$ که انعکاسات را در رنج طول موجی 600-1000 نانومتر به مقادیری در حدود کمتر از چهار درصد می‌رساند، پوشیده شده است [4].

پوششدار کردن سطح بالایی سلول توسط این لایه ها با توجه به ضریب شکست و ضخامت این لایه ها باعث افزایش ضریب جذب نوری و در نتیجه افزایش تعداد زوج الکترون- حفره های تولید شده و در نهایت افزایش چشمگیری در I_{sc} می‌شود [5]. همچنین بعلاوه وجود SiO_2 که در واقع همانند یک لایه عایق در این پوشش سه لایه ای عمل می‌کند، سرعت بازترکیب ها در سطح جلویی سلول کاهش خواهد یافت [6].

نتیجه این کاهش منجر به افزایش V_{oc} حدود 7 میلی ولت می‌شود. سلول نمونه C را با مشخصات سلول نمونه B در نظر بگیرید با این تفاوت که عامل BSF) BSF) کردن سلول پیوند p-n به معنی این است که لایه ای با ناخالصی زیاد (P^+) به ناحیه p در سطح پایینی سلول پیوند داده شود) را با چگالی ناخالصی $5 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$ و ضخامت $5 \mu\text{m}$ به آن اضافه کرده ایم. افزایش BSF به سلول منجر

ایجاد پیوند p-n ناخالصی فسفر را بر روی سطح p پخش می‌کنند [1].

به منظور بررسی چگونگی عملکرد این سلولها و همچنین اثر پارامترهای مختلف بر روی عملکرد آنها و در نهایت طراحی سلولهایی با بازدهی بهتر، نرم افزارهایی طراحی شده اند که به بررسی روابط حاکم بر این وسایل اپتوالکترونیکی می‌پردازند. پس از طراحی و شبیه سازی سلول ها، با توجه به محدودیت های عملی حاکم بر این وسایل، نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل می‌شوند. یکی از نرم افزارها یی که برای شبیه سازی سلول های خورشیدی طراحی شده، نرم افزار یک بعدی PC1D می‌باشد [2]. در این نرم افزار، معادلات ترابری حامل های بار در نیمه رسانا ها و معادله پواسون با استفاده از روش تکرار نیوتن حل می‌گردد و سپس تأثیر پارامترهایی مانند پوششهای ضد بازتاب، میزان ناخالصی زمینه (بیس)، عامل BSF (Back Surface Field)، ضخامت سلول، پخش ناخالصی فسفر برای امپدانس، طول پخش حاملها و دمای سلول بر عملکرد سلول های خورشیدی مطالعه می‌گردد. در واقع هدف اصلی این شبیه سازی ها این است که با انتخاب مناسب پارامترهای موثر، بازدهی سلول را به بالاترین مقدار برسانیم و اصطلاحاً سلول را بهینه سازی کنیم [3].

از مقایسه بازده سلولهایی با مشخصات معین، که توسط نرم افزارها شبیه سازی شده اند و سلولهای ساخته شده در آزمایشگاه با همان مشخصات، مشاهده می‌شود که معمولاً بازدهی بدست آمده برای سلولهای آزمایشگاهی کمتر از بازدهی محاسبه شده می‌باشد. یکی از دلایل این امر را می‌توان ناشی از این عامل دانست که مقادیر اندکی از نور خورشید که به سطح سلول می‌تابد توسط پوشش ضد بازتاب جذب می‌شود، که در محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود.



باز ترکیب‌های سطحی بواسطه افزایش سطح سلول دانست.

2- میزان ناخالصی بیس

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم برای ساخت زمینه p سلولهای خورشیدی، سیلیسیم بلوری خالص شده را توسط بور بطور یکنواخت ناخالص می‌کنند. سوالی که در این قسمت مطرح می‌شود در مورد میزان و چگالی این ناخالصیها می‌باشد. در این بخش به بررسی تاثیر این ناخالصیها (N_A) بر روی پارامترهای سلول می‌پردازیم. در شکل های 1، 2 و 3 نتایج محاسبات تغییر ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه و بازدهی سلول بر حسب میزان

ناخالصی زمینه (بیس) نشان داده شده است. همانطور که در شکل 1

نوع سلول	$I_{sc}(mA)$	$V_{oc}(mV)$	بازده %
A	23/7	595/2	10/6
B	31/7	602/7	14/7
C	32/4	606/7	15/1
D	33/7	596/5	15/5

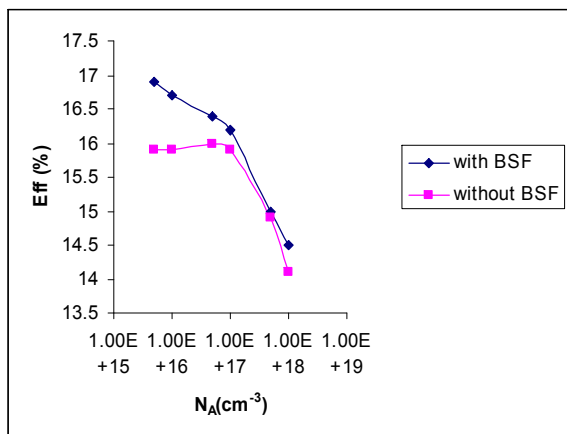
مشاهده می‌شود. با افزایش ناخالصی زمینه، V_{oc} نیز افزایش یافته و در ناخالصی 1×10^{17} ماکزیم می‌گردد و سپس با افزایش بیشتر ناخالصی بیس، بعلاوه غالب شدن اثرات باز ترکیب های ناخالصی (خصوصاً باز ترکیب اوزه)، کاهش می‌یابد. شکل 1: تغییرات V_{oc} بر حسب ناخالصی زمینه

در شکل 2 تغییرات جریان اتصال کوتاه با افزایش ناخالصی بیس نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که، بعلاوه افزایش باز ترکیب های حجمی، جریان اتصال کوتاه با افزایش ناخالصی کاهش می‌یابد. بنابراین ملاحظه می‌کنیم که به يك تناقض رفتاری بین I_{sc} و V_{oc} می

به کاهش باز ترکیب ها در سطح پایینی سلول می‌شود همچنین ارتفاع سد پتانسیل بین فلز و نیم رسانا در اثر این عامل افزایش می‌یابد [7]. بنابراین جریان اشباع معکوس I_0 کاهش می‌یابد و منجر به افزایش V_{oc} می‌شود همچنین در نظر گرفتن این عامل در سلول باعث می‌شود که در محل اتصال نیم رسانا با فلز در پایین سلول، تماسهایی با مقاومت اهمی کوچک داشته باشیم که منجر به کاهش اتلاف توان و افزایش بازده سلول می‌گردد (جدول 1). همانطور که از جدول 1 مشاهده می‌شود با در نظر گرفتن این عامل افزایشی 4 میلی ولتی در V_{oc} خواهیم داشت. جدول 1: مقایسه پارامترهای بازدهی چهار سلول معرفی شده

عامل دیگری که باعث افزایش کارایی سلول می‌شود بافت دار کردن سطوح سلول است. سلول D را با مشخصات سلول C می‌گیریم. که سطح رویی آن را با زاویه 75 درجه و عمق 5 میکرومتر بافتدار کرده ایم. همانطور که از جدول 1 مشاهده می‌شود این عامل باعث افزایش I_{sc} می‌شود زیرا بافت دار کردن سطوح باعث می‌شود که ضریب جذب به صورت $\alpha/\cos\theta$ افزایش می‌یابد [8]. به علاوه با بافت دار کردن سطح سلول در واقع سطحی که در مقابل تابش نور قرار می‌گیرد افزایش می‌یابد. با توجه به این دو عامل، تولید زوج الکترون - حفره و بنابراین I_{sc} افزایش می

یابد. همانطور که از جدول 1 مشاهده می‌شود این عامل باعث افزایش I_{sc} در حدود 1/5 میلی آمپر می‌شود. بعلاوه در این نمونه V_{oc} سلول با این عامل کاهش یافته است که دلیل آن را می‌توان ناشی از افزایش



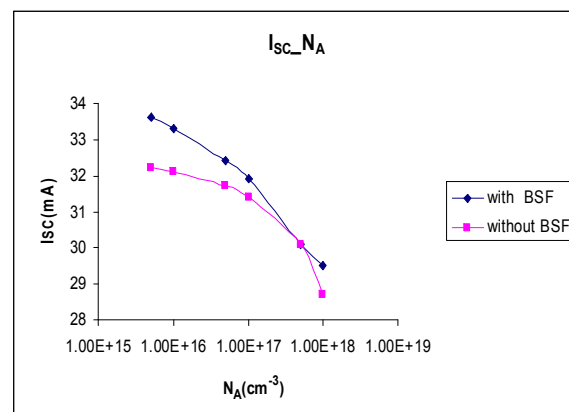
شکل 3: تغییرات بازدهی سلول با تغییر میزان ناخالصی زمینه

مراجع:

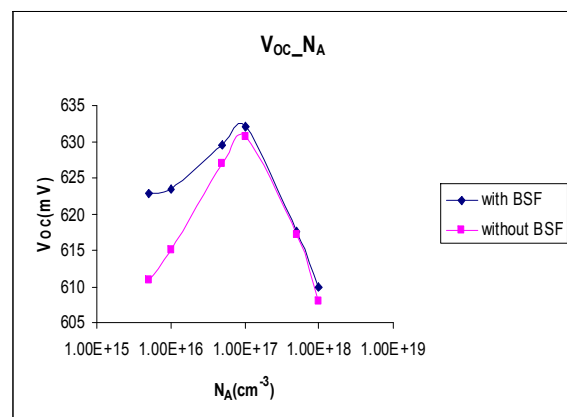
- [1] M.A.Green; "Solar Cell Operating Principles, Technology and System Applications", (1982).
- [2] D. A. Clugston, and P.A Basore, " PC1D Version 5:32-bit solar cell simulation on Personal computers ", Proc .26 TH IEEE Photovoltaic Specialists Conf. Anaheim CA (IEEE NewYork , 1997) P.207.
H. J. Hovel;" Solar Cells, Semiconductor and Semimetals Series" (New York, Academic press), (1975).
- [3] A. Meijerink, R. E. L. Schropp, " Modeling Improvement of Spectral Response of Solar Cells by Deployment of Spectral Converts Containing Semiconductor Nano-crystalline "; 8 (2004).
- [4] E. S. Heavens, "Optical Properties of Thin Solid Films", (London, Butterwarths)(1955).
See also [http:// www.thinfilmcenter.com/](http://www.thinfilmcenter.com/).
- [5] H.B.Serreze," Optimization Solar Cell by Simultaneous Consideration of Grid Pattern Design and Interconnect Configuration", pp. 609-614 . (2002) . [7] P. A. Bsore, "Extended Spectral Analysis of Internal Quantum Efficiency", 23rd IEEE PVSC, (1993), pp. 147-152.
- [6] J. Streentman, "Solid State and Semiconductor Devices" (1978).

رسیم. لذا بهتر است که برای هر سلول با مشخصات معین با توجه به تناقض ذکر شده مقدار بهینه ای برای ناخالصی زمینه در نظر بگیریم تا در این مقدار، پارامترهای سلول برای رسیدن به بازدهی بهتر بهینه شوند.

در شکل 3 تغییرات بازدهی سلول بر حسب ناخالصی زمینه رسم شده است. با توجه به این نمودار مقدار بهینه ناخالصی زمینه که به ازای آن بیشترین بازدهی حاصل می گردد، حدود $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ به دست آمد. همچنین می توانیم در شکل های 1، 2 و 3 اثر در نظر گرفتن عامل BSF را نیز بررسی پارامترهای سلول ملاحظه کنیم. با توجه به این نمودارها مشاهده می شود که عامل BSF باعث افزایش پارامترها، در سلولهایی که چگالی ناخالصی زمینه آنها کمتر از 1×10^{17} است، خواهد شد و در زمینه هایی که به شدت ناخالص شده اند اثر قابل توجهی بر روی پارامترهای سلول ندارد.



شکل 2: تغییرات جریان اتصال کوتاه بر حسب تغییرات میزان ناخالصی زمینه





سومین همایش علمی- تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - 23 الی 25 آذر 1387